

OpticStudio 16.5 SP4 版本說明

OpticStudio 16.5 Service Pack 4 包含以下修正與改進。

操作性改善

熱鍵 – 修正了一個在 OpticStudio 中使用 ALT 相關熱鍵時的問題。

公差分析 – 現在從 ZPL 巨集呼叫執行公差分析時，系統僅會在複製的光學系統上做修改，而不是修改使用者正在操作的光學系統。

序列式表面以及光線追跡

Zone Plate 表面 – 修正一個關於序列式表面 Zone Plate 的外型的問題，這個問題發生在當 Mode 欄位設為 1 的時候，中心的矢高計算會不正確。

光線瞄準 (Ray Aiming) – 改進了當非球面是第一面時，光線瞄準演算法的準確性。

光瞳位移係數 (Pupil shift factors) – 更新了光線瞄準中自動計算光瞳位移係數的演算法，以更好的支援旋轉對稱系統。

非球面轉換工具 – 更新此工具的演算法，現在當表面歸一化半徑跟光學孔徑不同的時候，也能正確計算。

傾斜/位移元件工具 – 修正這個工具運作時，對於 TCE 參數的設定問題。

序列式分析與計算

物理光學傳播 – 在 Shaded Model 中顯示傾斜表面上，物理光學傳播計算結果的演算法已經被改進了。

光瞳偏振圖 (Polarization Pupil Map) – 修正了偏振橢圓的方向在文字模式與繪圖模式有時候不一樣的問題。

光源分析 – 序列模式中的光源分析工具現在支援 DAT 檔。

縱向像差計算 (Longitudinal aberration calculation) – 修正計算操作數 LONA 時，如果使用近軸光線決定近軸像面位置 (Zone = 0)，且系統為無焦系統時產生的問題。

非序列物件與光線追跡

Source Diode – 修正非序列模式中這個光源運作在大角度下時發生的問題。

動態 CAD 連結 – 非序列模式下動態 CAD 連結現在支援最新版的 PTC Creo Parametric。因為新版 Creo Parametric 4.0 改動了資料庫，非序列元件 CAD Part: Creo Parametric 以及 CAD Assembly: Creo Parametric 將不再支援舊版的 Creo Parametric。

BSDF 表面散射 – 修正了各項異性的 BSDF 檔的方位角 0 度與 360 度可能互換的問題。我們開發了 MATLAB 工具來內插這種 BSDF 資料，並產生較高解析度的檔案以輸入回到 OpticStudio；需要這些工具請聯繫 support@zemax.com。

資料庫

Edmund Optics 鍍膜 – 新增 54 個 Edmund Optics 的加密鍍膜。這些鍍膜將會被應用在下一版更新的 Edmund Optics 鏡片目錄，這個目錄預計在下一版的 OpticStudio 版本中加入。

Schott 材料庫 – Schott 材料庫已經更新，材料庫中的總材料數沒有改變，但有兩個原本分類為 Preferred 的材料現在被改為 Special。

大阪瓦斯材料庫 – 大阪瓦斯材料庫已經更新。目前的材料總數為 6 個。

OptoSigma 以及 Sigma Koki 鏡片目錄 – OptoSigma 以及 Sigma Koki 的資料已經合併了，因此雖然在 OpticStudio 裡面兩個資料庫都存在，他們的內容是一樣的，一共有 1,771 的鏡片。